

日本学術会議公開シンポジウム 「人工光合成研究の最前線 -資源・環境・エネルギー課題解決と新産業創成のための革新的科学技術開発-

日時：2015年12月9日（水）13:00-18:10

場所：日本学術会議講堂 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」5番出口徒歩1分

主催：日本学術会議 化学委員会・総合工学委員会・材料工学委員会合同 触媒化学・化学工学分科会

文部科学省研究費補助金 新学術領域「人工光合成による太陽エネルギーの物質変換：実用化に向けての異分野融合」（AnApple）

国立研究開発法人科学技術振興機構

人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPCChem)「二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発（人工光合成プロジェクト）」

共催：東京理科大学 研究戦略・産学連携センター

問合せ・申込先：東京理科大学 工藤昭彦 E-mail: a-kudo@rs.kagu.tus.ac.jp

([kuboki\\_kozue@admin.tus.ac.jp](mailto:kuboki_kozue@admin.tus.ac.jp)宛にもお送りください)

※どなたでも参加できます。参加費は無料です。準備の関係上、上記宛に事前に参加申し込みしていただくと助かります。

## プログラム

13:00 趣旨説明，人工光合成とは，世界の研究動向

工藤 昭彦（日本学術会議連携会員、東京理科大学）

13:30 科研費新学術領域およびJST さきがけプロジェクトにおける人工光合成関連研究

井上 晴夫（日本学術会議連携会員、首都大学東京）

14:10 JST ACT-C プロジェクトにおける人工光合成関連研究

国武 豊喜（公益財団法人北九州産業学術推進機構理事長）

14:50 NEDO 人工光合成プロジェクトの紹介と産業界から見た人工光合成技術

瀬戸山 亨（(株)三菱化学）

16:00 官側からの視点「人工光合成による水素と有用化学物質製造」

佐山 和弘（産業技術総合研究所）

16:40 大学からの研究成果「光触媒材料を用いる水分解反応」

堂免 一成（東京大学）

17:20 産業界からの研究成果「水と二酸化炭素からギ酸を合成する人工光合成技術の現状」

森川 健志（株式会社豊田中央研究所）

18:00 閉会の挨拶 阿尻 雅文（日本学術会議第三部会員、東北大学）